

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成22年4月15日 (2010.4.15)

【公開番号】特開2009-158810(P2009-158810A)

【公開日】平成21年7月16日 (2009.7.16)

【年通号数】公開・登録公報2009-028

【出願番号】特願2007-337248(P2007-337248)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/304 (2006.01)

B 2 4 B 37/00 (2006.01)

C 0 9 K 3/14 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/304 6 2 2 D

B 2 4 B 37/00 H

C 0 9 K 3/14 5 5 0 Z

C 0 9 K 3/14 5 5 0 D

【手続補正書】

【提出日】平成22年2月26日 (2010.2.26)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 5 8

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 5 8】

このように、実施例 1 ~ 5 の C M P 用スラリーは、比較例 1 ~ 4 の C M P 用スラリーに対し、ファングの抑制効果およびスクラッチ数の低減効果に優れ、かつ S i O₂ 膜（第 2 の絶縁膜）の研磨速度の向上効果、すなわち S i O₂ 膜を確実に削りきり、S i O C 膜（第 1 の絶縁膜）を露出させる能力が高まっている。これは重量平均分子量が 1 0 0 万以上 1 0 0 0 万以下のポリアクリル酸（水溶性高分子）と、 β -シクロデキストリンとを同時に用いることによって初めて得られる相乗的效果である。